

(権利保護基盤の強化に関する専門調査会資料)

平成 17 年 3 月 1 日

根本特殊化学株式会社

代表取締役 根本 郁芳

知的財産を巡る問題点 我社の経験から特に指摘したいこと

1 権利化及び訴訟に長期間を要することに係る問題

我社の N 夜光に係る特許登録に要した期間

日本：3 年 2 ヶ月 (cf. 米国：最短 2 年 1 ヶ月、中国：最長 11 年)

訴訟に係る事例 日本 C 社の場合 (この外にも 2 件継続中)

一審勝訴 (訴訟提起から 3 年 5 ヶ月)

二審勝訴・確定 (二審控訴から 1 年 7 ヶ月 累計満 5 年)

この間に市場価格が形成されるという問題

少なくとも訴訟確定までの間は、侵害行為差し止めはできず、侵害品と競合関係にある。侵害品は、開発費等の負担がなく、低価格での参入が可能で、これが市場価格を形成することになり、これが長期間であるほど定着してしまい、影響は大きくなる。 最大の問題

その後勝訴しても、市場価格を引き上げることは困難で、かつ、損害賠償額は、原告が侵害を挙証した範囲で、しかも得べかりし利益の範囲内でしかないため、真の損害補填には程遠く、侵害者も侵害し得というのが実態である。

侵害行為を防止するためには、賠償額の引き上げが必要と感じる。

特許期間の減少の問題

特許として保護される期間は 20 年であるが、(特許成立 + 訴訟) により本事例でも 8 年を要して、事実上有効に活用できる期間は約半分となっている。開発投資の回収期間の減少を意味し、開発意欲を減殺する方向に働く。

訴訟費用負担が多額になるという問題

訴訟期間長期化により、訴訟費用は、多額になり、その負担は重い。

中小企業にとっては、深刻な問題である。

訴訟費用敗訴者負担、知的財産保険の実質的機能化を求めたい。

2 中国における知的財産の問題点

前記 1 のとおり、中国にとっては、成立までに 11 年を要している。

企業が (特に中小企業が) 個別に対応するには限界がある。

国対国として、知的財産に係る正当な運営がなされるよう、強く要求し、実現を図ることが急務であると考えている。

以 上